*В. А. СТОРОЖЕНКО*, д-р техн. наук, проф., ХНУРЭ, Харьков; *О. В. ЛАЗОРЕНКО*, д-р физ.-мат. наук., проф., ХНУРЭ, Харьков; *А. В. МЯГКИЙ*, асп., ХНУРЭ, Харьков

# ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕПЛОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ СОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ПОМЕХ

Статья посвящена борьбе с помехами вида неоднородности нагрева, неоднородности излучательной способности поверхности изделия, а также помехой, вызванной разнотолщинностью клеевого слоя, при обнаружении методом тепловой дефектоскопии дефектов типа непроклей в сотовых конструкциях. Методы снижения указанных типов помех основаны как на выборе соответствующего режима контроля, так и на обработке результатов термографирования (термограмм и термофильмов) с учетом природы соответствующих помех.

Ключевые слова: тепловая дефектоскопия, сотовая конструкция, помехи, вейвлет анализ.

**Введение.** В последние годы в различных областях науки и техники все активнее используются новые материалы и конструкции, в частности, конструкции с сотовой структурой.

К сожалению, как известно, усложнение любой системы, с одной стороны, повышает ее возможности, а с другой стороны, ведет к снижению надежности такой системы. Это же наблюдается и при использовании сотовых конструкций. Один из существенных недостатков – это возникновение дефектов во время технологического процесса их изготовления. Как правило, выделяют несколько типов таких дефектов, а именно: отслоение, непроклей, расслоение, деформация сотового наполнителя.

Известно, что для выявления дефектов типа «непроклей» перспективно применение активного метода теплового контроля [1,2] при использовании тепловизора в качестве регистрирующего устройства. Последнее объясняется тем, что тепловизор обладает высокой чувствительностью к обнаружению подобных дефектов и большой производительностью контроля.

Однако реализовать потенциальные возможности этого метода на практике не всегда удается вследствие наличия значительных помех, обусловленных неоднородностью излучательной способности поверхности сотовой структуры и разнотолщинностью клеевого слоя. Кроме того, для создания избыточного температурного поля необходим одновременный нагрев определенной площади объекта контроля (ОК) площадочным нагревателем, для которого характерна неравномерность температурного поля, создаваемого на поверхности ОК. В частности, имеет место так называемый «краевой эффект», что представляет собой дополнительную помеху. Попытаться устранить указанные недостатки можно как на этапе проведения измерений, так и при обработке полученных результатов. Этим объясняется *актуальность* данной работы.

Целью настоящих исследований являлся поиск путей подавления указанных помех как путем оптимизации режима тепловой дефектоскопии (ТДС), так и путем создания алгоритмов обработки ее результатов (термограмм).

Для достижения поставленной цели использовался теоретикоэкспериментальный подход, сочетающий в себе построение и анализ теплофизической

© В. А. Стороженко, О. В. Лазоренко, А. В. Мягкий, 2013

модели сотовой структуры и проведение эксперимента на реальных образцах с дефектами.

### Теоретические исследования

В качестве геометрической модели ОК выбрана трехслойная пластина (что адекватно отражает реальную конструкцию сотовой структуры), состоящая из углепластиковой обшивки, между двумя слоями которой помещен сотопласт с неоднородностью (рис. 1). Дефект типа «непроклей» между обшивкой и сотопластом моделируется воздушной прослойкой.

При описании происходящих процессов нами используется цилиндрическая система координат  $(r, \varphi, z)$ , где r – радиальная координата, z – вертикальная координата. Угловая координата  $\varphi$  из расчетов исключена в виду того, что представленная модель ОК обладает центральной симметрией.





В предложенной теплофизической модели неоднородный по структуре слой сотопласта (рис. 2) был заменен однородным эквивалентным слоем с усредненными теплофизическими характеристиками (ТФХ): удельной теплоемкостью c', плотностью  $\rho'$  и коэффициентом теплопроводности  $\lambda'$ . Для определения усредненных значений использованы следующие соотношения:

$$c' = \langle c \rangle = \frac{V_1 C_1 + V_2 C_2}{V_1 + V_2},$$
(1)

$$\rho' = \langle \rho \rangle = \frac{V_1 \rho_1 + V_2 \rho_2}{V_1 + V_2} , \qquad (2)$$

$$\lambda' = \langle \lambda \rangle = \frac{V_1 \lambda_1 + V_2 \lambda_2}{V_1 + V_2}, \qquad (3)$$

где <sub>V1</sub> – объем полимера;

 $V_2$  – объем воздуха;  $c_1, \rho_1, \lambda_1 - T\Phi X$  полимера;  $c_2, \rho_2, \lambda_2 - T\Phi X$  воздуха.



Рис. 2 – Схема слоя сотопласта, состоящего из ячеек с полимерными стенками, заполненных воздухом

На внешних поверхностях ОК выполняются граничные условия 2-го и 3-го рода:

$$z = H: \qquad \left(\lambda(\vec{r}, t) \frac{\partial T(\vec{r}, t)}{\partial z}\right) = \alpha \left(T(\vec{r}, t) - T_{cpe\partial_{bl}}\right) - q(\vec{r}, t), \tag{4}$$

$$z = 0: \qquad -\lambda(\vec{r}, t) \frac{\partial T(\vec{r}, t)}{\partial z} = -\alpha \left( T(\vec{r}, t) - T_{cpe\partial_{bl}} \right), \tag{5}$$

$$z = h: \qquad -\lambda_1(\vec{r}, T, t) \left( \frac{\partial T_1(\vec{r}, t)}{\partial z} \right) = -\lambda_2(\vec{r}, T, t) \left( \frac{\partial T_2(\vec{r}, t)}{\partial z} \right) \tag{6}$$

где  $T(\vec{r},t)$  – координатно-временная функция температуры;

 $\lambda(\vec{r}, T, t)$  – коэффициент теплопроводности материалов ОК;

 $q(\vec{r},t)$  – плотность потока тепла от внешнего источника (нагревателя).

Теплофизическая модель, основанная на геометрической модели (рис. 1), описывается граничными условиями (4) – (6), отражающими реальные условия

проведения ТДС [1], т.е. нагрев ОК внешним источником тепла q и теплообмен с окружающей средой с коэффициентом  $\alpha$ .

Особенностью данной модели в отличие от ряда известных [1, 3] является одновременный учет и теплоотдачи с нагреваемой поверхности, и теплопроводности через дефект (воздух).

Анализ построенной теплофизической модели производится путем решения нестационарного дифференциального уравнения теплопроводности [4], записанного для выбранной цилиндрической системы координат:

$$div(\lambda(\vec{r},T)\nabla T(\vec{r},t)) + q(\vec{r},t) = c\rho \frac{\partial T(r,t)}{\partial t}$$
(7)

Для решения уравнения (7) применялся численный (сеточный) метод конечных разностей.

Этот метод успешно реализован в ранее разработанном авторами программном пакете «TermoPro\_2009S» [5]. В качестве числового материала использовались справочные данные по одной из разновидностей сотовых структур (табл. 1).

Характеристики материалов	Углепластик обшив- ки	Полимерный сотовый заполнитель
Теплопроводность (Вт/м К)	0,3-0,9	0,065
Степень черноты	0,8-0,82	-
Толщина (мм)	0,8	28
Размер ячейки (мм)	-	2,5

Таблица 1 – Характеристики материалов ОК

Численные параметры моделируемого дефекта (воздушная прослойка) были выбраны следующими: глубина залегания h = 0,8 мм (что соответствует толщине обшивки), раскрытие (толщина)  $\delta = 0,2$  мм (соответствует толщине клеевого слоя), поперечный размер l = 5 мм (соответствует размеру двух ячеек).

Анализ разработанной теплофизической модели осуществлялся по методике, заложенной в указанном выше программном пакете. Ее суть вкратце такова.

Проводилось решение уравнения (7) с граничными условиями (4) – (6) относительно искомой величины в виде температурного контраста  $\Delta T$  на поверхности ОК над местом залегания дефекта [1]. При этом варьировались параметры режима проведения ТДС: плотность потока тепла q, продолжительность нагрева поверхности ОК  $\tau_{\rm H}$ , время запаздывания  $\tau_3$  (промежуток времени между окончанием нагрева и регистрацией температурного поля). Макси-

мальная температура нагрева поверхности ОК ограничивалась значением 100°С (во избежание деструкции материала).

Из полученного массива значений q,  $\tau_{\rm H}$ ,  $\tau_{\rm 3}$  определялся оптимальный режим ТДС по критерию  $\Delta T \rightarrow \Delta T_{\rm max}$  (табл. 2).

$q$ , к $\mathrm{Bt/m^2}$	$\tau_{\rm H}$ , c	$ au_3$ , c	$\Delta T_{\rm max}, {\rm °C}$
28	15	4,4	1,61

Таблица 2 – Результаты расчета оптимального режима ТДС

## Экспериментальные исследования

Для проверки результатов, полученных теоретическим путем, были проведены экспериментальные исследования на образце сотовой структуры, параметры которой приведены в табл. 1. Образец содержал два искусственных дефекта типа «непроклей» с размерами:

1) 40 х 70 (мм)

2) 20 х 80 (мм)

Остальные параметры дефектов соответствовали расчетным: глубина h = 0,8 мм, раскрытие  $\delta = 0,2$  мм.



Рис. 3 – Внешний вид исследуемой пластины с обозначенными местами расположения дефектов

Для проведения экспериментов использовался тепловизор IRTIS – 200 в сочетании с созданным авторами площадочным нагревателем излучательного

типа с неравномерностью нагрева по полю кадра 12%. Время нагрева  $\tau_{\rm H}$  регулировалось таймером.

На рис. 4 в качестве примера приведены две из множества полученных термограмм, иллюстрирующие влияние режима контроля на сигнал от дефекта, т. е. величину температурного контраста  $\Delta T$ .



*a* – в оптимальном режиме (средняя температура по поверхности  $T_{cp}$  = 33,36 °C);  $\delta$  – в неоптимальном режиме (средняя температура по поверхности  $T_{cp}$  = 32,01 °C)

Из термограмм видно, что в оптимальном режиме тепловой контраст, вызванный дифектом в правом верхнем углу ОК ( $\Delta T = 1,53$  °C), существенно выше, чем в неоптимальном ( $\Delta T = 0,54$  °C). Где  $\Delta T = T_c - T_o$ ,  $T_c$  - средняя температура по кадру,  $T_o$  - температура над дефектом.

Таким образом за счет оптимизации проведения контроля удается повысить величину сигнала от дефекта и улучшить его выявляемость.

Однако наряду с полезным сигналом на термограммах присутствуют и температурные контрасты вызванные помехами (шумовой сигнал), сопоставимые по величине с полезным сигналом:  $\Delta T_{\rm m} = 2,6$  °C. Это не позволяет однозначно идентифицировать дефекты по амплитудному принципу, т. е. по величине температурного контраста  $\Delta T$ .

## Подавление помех путем обработки результатов ТДС

Подавление помехи неоднородности нагрева путем обработки результатов ТДС с использованием вейвлет- анализа.

Одним из важнейших факторов успешного обнаружения тепловых дефектов типа «непроклей» является использование в экспериментальных исследованиях для одновременного нагрева заданной площади ОК площадочного нагревателя, который в идеальном случае мог бы создавать равномерное температурное поле по всей нагреваемой поверхности. К сожалению, на практике в подавляющем большинстве случаев этого достичь не удается. В частности, имеет место так называемый «краевой эффект», что представляет собой, разумеется, дополнительную помеху.

Поэтому постараться снизить негативное влияние неравномерности нагрева исследуемой поверхности ОК можно на этапе цифровой обработки полученных экспериментальных данных.

В качестве одного из возможных вариантов такой обработки предлагается использование возможностей аппарата вейвлет-анализа.

Вейвлет-анализ, сформировавшийся как математический аппарат в конце 1980-х – начале 1990-х гг., успешно применяется в самых различных областях науки и техники. На сегодняшний день вейвлеты уже нашли широкое применение в задачах распознавания и идентификации образов, при обработке и синтезе сигналов, при анализе изображений и т. п. [6, 7].

Основная идея вейвлет-преобразования, в частности, одномерного сигнала состоит в его разложении по базису, сконструированному из обладающей определенными свойствами локализованной функции (вейвлета) посредством масштабных изменений и переносов. Каждая из функций этого базиса характеризует как определенную пространственную (или временную) частотную составляющую сигнала, так и локализацию этой составляющей в физическом пространстве (или времени) [6].

Аппарат вейвлет-анализа включает в себя большое количество всевозможных вейвлет-преобразований (ВП) [6, 7], однако в этой работе нас интересуют одномерное и двумерное диадные ВП. Рассмотрим их подробнее.

Известно, что для ортонормальных вейвлетных базисов на двоичной решетке разработаны алгоритмы кратномасштабного анализа (КМА). КМА основывается на следующих предпосылках:

- ✓ пространство сигналов *v* может быть разбито на иерархически вложенные подпространства  $V_j$ , которые не пересекаются и объединение которых дает в пределе  $L^2(\mathbb{R})$ ;
- ✓ для любой функции  $s(t) \in V_j$  ее сжатая версия принадлежит пространству  $V_{i-1}$ ;
- ✓ существует такая функция  $\varphi(x) \in V_0$ , для которой ее сдвиги  $\varphi_{0,k} = \varphi(t-k), k \in \mathbb{Z}$  образуют ортонормированный базис пространства  $V_0$ .

Тогда поскольку функции  $\varphi_{0,k}(t)$  образуют ортонормированный базис пространства  $V_0$ , функции  $\varphi_{j,k}(t) = 2^{-j/2} \varphi(2^{-j}t - k)$  также образуют ортонормированный базис в  $V_0$ . Скейлинг-функцию  $\varphi(t)$  (отцовский вейвлет) принято называть масштабирующей функцией, так как она посредством  $\varphi_{i,k}(t)$  создает свои масштабированные версии в пространстве сигнала. Сигнал s(t) может быть представлен множеством последовательных приближений  $s_j(t)$  в подпространствах  $V_j$ . Переменная j называется масштабным коэффициентом. Сигнал s(t) является пределом аппроксимации  $s_j(t) \in V_j$  при  $j \to \infty$ , т. е.  $s(t) = \lim_{j \to \infty} s_j(t)$ . Поэтому при малых j получаются грубые приближения s(t), а при больших – точные.

Функция  $\Psi \in L^2(\mathbb{R})$ ; называется R-функцией, если базис  $\{\psi_{\mu}\}$ , определяемый выражением

$$\psi_{ik}(t) = 2^{-j/2} \psi(2^{-j}t - k), \ j, k \in \mathbb{Z};$$
(8)

где  $\mathbb{Z}$ ; – множество целых чисел, является базисом Рисса [6, 7], т. е. существуют две константы  $A_w$  и  $B_w$ ,  $0 < A_w \le B_w < \infty$ , для которых соотношение, называемое вейвлетным каркасом,

$$A_{w}\left\|\left\{c_{jk}\right\}\right\|^{2} \leq \left\|\sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{jk} \psi_{jk}\right\|^{2} \leq B_{w}\left\|\left\{c_{jk}\right\}\right\|^{2}$$

выполняется при любой (ограниченной, дважды квадратично суммируемой) последовательности  $\{c_u\}$ :

$$\left\|\left\{c_{jk}\right\}\right\|^{2} = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left|c_{jk}\right|^{2} < \infty \cdot$$

Базис Рисса является безусловным, т. е. в нем порядок размещения векторов может быть произвольным.

Любая локализованная R-функция  $\Psi \in L^2(\mathbb{R})$  называется R-вейвлетом (материнским вейвлетом или просто вейвлетом), если для нее существует функция  $\dot{\Psi} \in L^2(\mathbb{R})$ ; (ее пара, двойник), такая, что семейства  $\{\psi_{\mu}\}$  и  $\{\dot{\psi}_{\mu}\}$ , построенные по принципу соотношения (8) и

$$\dot{\psi}_{ik}(t) = 2^{-j/2} \dot{\psi}(2^{-j}t - k), \qquad j, k \in \mathbb{Z};$$

являются парными базисами функционального пространства  $L^2(\mathbb{R})$ .

Здесь  $\{\psi_{\mu}\}$  – «двойник» базиса  $\{\psi_{\mu}\}$  в том смысле, что скалярное произведение входящих в них функций удовлетворяет условию:

$$\langle \psi_{jk}, \dot{\psi}_{lm} \rangle = \delta_{jl} \delta_{km},$$

где <sub>*б*<sub>*il*</sub>, *б*<sub>*km*</sub> – символы Кронекера.</sub>

В общем случае реконструкция сигнала на *n*-ом уровне разрешения  $j_n$  задается выражением:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{j_n,k} \varphi_{j_n,k}(t) + \sum_{j=j_n}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_{j,k} \psi_k(t), \qquad (9)$$

где  $a_{j_{n,k}}$  и  $d_{j,k}$  – аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты на *n*-ом уровне разложения соответственно. Они определяются соотношениями:

$$a_{j_n,k} = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\varphi_{j_n,k}(t)dt \qquad d_{j,k} = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\psi_{j,k}(t)dt$$
 (10)

Вейвлет  $\psi(t)$  определяет тонкую структуру анализируемого сигнала, а скейлинг-функция  $\varphi(t)$  отвечает за его грубую аппроксимацию (см., например, [6, 7]).

Пара соотношений (9) и (10) определяет одномерное диадное вейвлет-преобразование.

В случае двумерного диадного вейвлет-преобразования одномерный исследуемый сигнал s(t) заменяется на функцию двух переменных s(x, y), частным случаем которой является изображение.

Тогда и вейвлетный базис тоже становится функцией двух переменных:

$$\psi_{j,k}(V) = 2^{-j/2} \psi(2^{-j}V - k), \quad \varphi_{j,k}(V) = 2^{-j/2} \varphi(2^{-j}V - k),$$
(11)

где  $V = x, y \in \mathbb{Z}^2$ ,  $(j, k) \in \mathbb{Z}^2$  В результате, любое изображение может быть представлено с помощью двумерного диадного вейвлет-преобразования, определяемого соотношениями (9) и (10) с использованием соотношений (11).

В рамках данной работы нас интересовала возможность выравнивания пространственного распределения теплового поля используемого нами нагревателя. Пример такого реального распределения приведен на рис. 5, а.

Предлагаемая идея вейвлет-обработки изображения состоит в следующем. Сначала используя прямое двумерное диадное вейвлет-преобразование, разлагаем исходное изображение нагревателя с применением максимально возможного количества уровней разложения n. Последнее определяется разрешением анализируемого цифрового изображения. Затем приравниваем нулю все аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты на этом максимальном уровне разложения и восстанавливаем изображение с помощью обратного двумерного диадного вейвлет-преобразования. В результате получаем существенно выравняное пространственного распределения теплового поля используемого нами нагревателя (рис. 5, б). Разность между исходным изображением и восстановленным демонстрируется на рис. 5, в. По сути дела, предложенный алгоритм реализует применение к исходному изображению фильтра низких пространственных частот, убирающего вариации теплового поля с наибольшими пространственными масштабами. Это не приводит к потере информации о дефектах, поскольку их характерные пространственные масштабы обычно оказываются меньше.





Вместе с тем, возникает вопрос выбора анализирующего вейвлета, поскольку на сегодня существуют сотни различных вейвлетов, в том числе и двумерных. Основным критерием отбора является геометрия теплового поля, создаваемого нагревателем. В нашем случае оно центрально симметрично, поэтому и анализирующий вейвлет должен быть симметричным. К тому же рекомендуется, чтобы он был достаточно гладким. Одним из таких вейвлетов является дискретный вейвлет Мейера (dmey), который и использовался нами в данной работе.

Далее полагаем, что воздействие всех мешающих факторов на реальный исследуемый образец является аддитивным. В этом случае для компенсации неоднородности пространственного распределения теплового поля нагревателя каждое исследуемое изображение реального образца необходимо обработать с помощью того же алгоритма, что и изображение нагревателя. Разумеется, должен использоваться тот же выбранный вейвлет и то же количество уровней разложения.

Снижение влияния неоднородности излучательной способности поверхности образца

Известно, что для оценки влияния неоднородности излучательной способности  $\Delta \varepsilon$  принято использовать эквивалентный ей температурный перепад

 $\Delta T_{e}$  [3]. С помощью описанной выше теплофизической модели было проведено исследование временной зависимости  $\Delta T_{e}(t)$ , т. е. помехи, в сравнении с аналогичной временной зависимостью температурного перепада от дефекта  $\Delta T_{de\phi}(t)$ , т. е. полезного сигнала.

Оказалось, что характер этих временных зависимостей принципиально отличается (рис. 6): моменты времени, соответствующие максимальным значениям помехи  $\Delta T_{c}(t)$  и полезного сигнала  $\Delta T_{doep}(t)$  не совпадают: сигнал от помехи достигает максимума сразу по окончании нагрева, т. е. в момент времени  $\tau_{\rm H}$ , а полезный сигнал – с определенным временем запаздывания  $\tau_{2}$ .

Этот факт открывает возможность максимизировать отношение сигнал/шум  $\Delta T_{\partial e \phi} / \Delta T_{\varepsilon}$ ) путем выбора соответствующего момента регистрации температурного поля на поверхности объекта контроля.

В частности, согласно данным рис. 6 при выборе времени контроля  $\tau_3 = 4,4$  с соотношение сигнал/шум равно  $\Delta T_{oe\phi} / \Delta T_{\varepsilon} = 1,2$ , а при  $\tau_3 = \tau_{orr} = 6,2$  с это отношение составляет  $\Delta T_{oe\phi} / \Delta T_{\varepsilon} = 1,6$ , что на 26% больше предыдущего.



Рис. 6 – Развитие во времени помехи  $\Delta T_{e}(t)$  (1) и сигнала от дефекта  $\Delta T_{oeb}(t)$  (2)

Данный вывод относительно выбора оптимального момента регистрации  $au_{onr}$  справедлив и для рассмотренной выше помехи, вызванной неравномерностью нагрева поверхности ОК.

Оптимизация режима контроля по критерию максимума отношения сигнал/помеха (вместо максимума полезного сигнала) позволяет оценивать порог чувствительности метода в зависимости от неравномерности излучательной способности  $\Delta \varepsilon / \varepsilon$ : можно определить минимальный поперечный размер дефекта r или его максимальную глубину залегания h [5].

#### Устранение помехи, вызванной разнотолщинностью клеевого слоя.

Разнотолщинность клеевого слоя можно представить как эквивалентное изменение термического сопротивления ОК, которое приводит к появлению температурных контрастов на его поверхности, достигающих значений (как показывает эксперимент) 4,2°С, что сопоставимо с полезным сигналом  $\Delta T$ , вызванным наличием дефекта. Однако анализ полученных экспериментальных данных показал, что эти контрасты отличаются от полезного сигнала пространственно-временной зависимостью  $\Delta T(\tau, x)$ . Этот факт лег в основу предложенного метода подавления этой помехи путем компьютерной обработки термограмм с использованием зависимости  $\partial T(x)/\partial x$  (рис. 7).



Рис. 7 – Частная производная от температуры поверхности по времени в зависимости от координаты для области: *a* – для участка с помехой; *б* – над дефектом

Суть данного метода заключается в вычислении двумерной матрицы, элементами которой являются соответствующие частные производные по времени:

$$F_{i,j} = \frac{\partial F'_{i,j}(x,y)}{\partial t}, \qquad (5)$$

где  $F'_{i,j}(x, y)$  – элемент матрицы скорректированных температур;

*i*, *j* – целые числа, номера соответствующих пикселей по х и у;

*F*<sub>*i*,*i*</sub> – элемент характеристической матрицы.

Расшифровав  $F_{i,j}$ , используя зависимости, приведенные на рис. 7, получаем конечный вид термограммы после обработки (рис. 9). Сравнение этой термограммы с исходной (рис 8) подтверждает тот факт, что достоверность обнаружения дефектов (даже визуальным путем) существенно возросла после обработки. Количественная же оценка показывает уменьшение сигнала помехи данного вида более чем в 1,5 раза.

Последнее является крайне важным, поскольку создает предпосылки для перехода в условиях производства от визуальной идентификации дефектов к автоматизированной.



Рис. 8 – Исходная термограмма



Рис. 9 – Термограмма после обработки

## Выводы.

1. Разработана теплофизическая модель ОК, более полно (по сравнению с аналогами) отражающая реальные условия проведения тепловой дефектоскопии сотовых конструкций и, благодаря этому, позволяющая оценивать ожидаемую величину сигнала от дефекта с достаточной точностью (погрешность порядка 10%).

2. Создана методика оптимизации режима проведения тепловой дефектоскопии, основанная на критерии максимизации не самого полезного сигнала, а соотношения сигнал/шум, что позволяет расширить границы применимости метода на ОК, поверхность которых имеет неравномерность излучательной способности  $\varepsilon$ .

3. Предложены методы для борьбы с помехами, вызванными неоднородностью нагрева, неоднородностью излучательной способности поверхности образца и разнотолщинностью клеевого слоя, как за счет оптимизации метода контроля, так и за счет обработки полученных результатов, в частности, использования методов вейвлет-анализа. 4. В результате применения предложенных методов было достигнуто снижение уровня помех связанных с неоднородностью нагрева до  $0,7^{\circ}$ С (вместо  $1,4^{\circ}$ С), снизить помеху, вызванную неоднородностью излучательной способности  $\varepsilon$ , удалось до  $0,6^{\circ}$ С (вместо  $2^{\circ}$ С), а температурный контраст, вызванный разнотолщинностью клеевого слоя, снизить до  $0,2^{\circ}$ С (вместо  $1,2^{\circ}$ С).

Список литературы: 1 Стороженко В.А., Маслова В.А. Термография в диагностике и неразрушающем контроле. – Х.: «Смит», 2004. – 160 с. 2. Xavier P. V. Maldague. Theory and Practice of Infrared Technology for Nondestructive Testing. – John Wiley & Sons, Inc., 2001, р. 684. 3. Вавилов В.П. Инфракрасная термография и тепловой контроль. – М.: ИД Спектр, 2009. – 544 с.: ил. и цветная вкладка 16 с.4. Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М.: Высшая школа, 1967. – 602 с.5. Стороженко В.А., Малик С.Б., Мягкий А.В. Оптимизация режимов тепловой дефектоскопии на основе теплофизического моделирования // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Прилади і методи неруйнівного контролю. – Харків: НТУ «ХПІІ» – №48. – 2008. – С. 84 – 91.6. Mallat S. A Wavelet Tour of Signal Processing. The Sparse Way. – N. Y.: Academic Press, 2008. – 805 р.7. Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Сверхширокополосные сигналь и процессы. Монография. – Х.: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2009. – 576 с.

Надійшла до редколегії 15.04.2013

#### УДК 621.396.6

Обработка результатов тепловой дефектоскопии сотовых конструкций с целью понижения уровня помех/ В.А.Стороженко, О.В. Лазоренко, А. В. Мягкий// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 34 (1007). – С. 108–112. – Бібліогр.: 7 назв.

Стаття присвячена боротьбі із завадами виду неоднорідності нагрівання, неоднорідності випромінювальної здатності поверхні виробу, а також завадою, що викликана різнотовщинністю клейового шару, при виявленні методом теплової дефектоскопії дефектів типу непроклей в стільникових конструкціях. Методи зниження вказаних типів завад базуються як на виборі відповідного режиму контролю, так і на обробці результатів термографіювання (термограм та термофільмів) з урахуванням природи відповідних завад.

Ключові слова: теплова дефектоскопія, стільникова конструкція, завада.

The paper is devoted to heating nonuniformity, emissivity nonuniformity, and thickness variation of the adhesive layer interferences reduction techniques at starved spot detection in a honeycomb sandwich by the thermal test. Those techniques are based on corresponding testing mode selection, thermal test results (infrared images and sequences) processing taking into account those interferences nature.

Keywords: thermal test, honeycomb sandwich, interference.